

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 1 月 12 日 (2006.1.12)

【公開番号】特開 2001-249460 (P2001-249460A)

【公開日】平成 13 年 9 月 14 日 (2001.9.14)

【出願番号】特願 2000-318057 (P2000-318057)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/039 (2006.01)

C 0 8 K 5/00 (2006.01)

C 0 8 L 101/06 (2006.01)

G 0 3 F 7/004 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 7/039 6 0 1

C 0 8 K 5/00

C 0 8 L 101/06

G 0 3 F 7/004 5 0 1

G 0 3 F 7/004 5 0 3 Z

G 0 3 F 7/004 5 0 4

H 0 1 L 21/30 5 0 2 R

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 11 月 21 日 (2005.11.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 (a) 下記一般式 (I) で示される酸分解性基を有し、酸の作用により分解し、アルカリ現像液中での溶解度が増大する樹脂、

(b - 1) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生し、前記酸分解性基の分解反応に寄与する化合物のうち少なくとも 1 種、

(b - 2) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生し、前記酸分解性基の分解反応に寄与しない化合物のうち少なくとも 1 種、

(c) 界面活性剤、及び

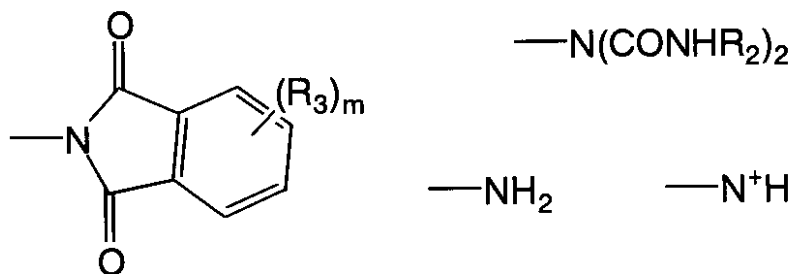
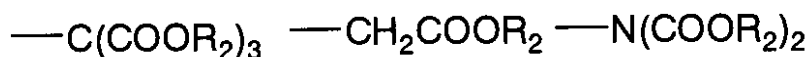
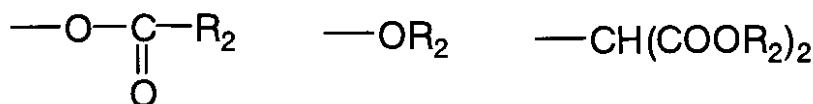
(d) 溶剤

を含有することを特徴とするポジ型感放射線性組成物。

【化 1】

$$\text{---O---}\overset{\text{H}}{\underset{\text{R}_1}{\text{C}}}\text{---O---(CH}_2\text{)}_n\text{---W}$$

【化 2】



R₃は、水素原子、炭素数1～6個の直鎖状、分岐状あるいは環状のアルキル基、炭素数1～6個の直鎖状、分岐状あるいは環状のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、水酸基、又はシアノ基を表す。

X は、ハロゲン原子を表す。

R₄ は、置換あるいは無置換のアリール基、又は置換あるいは無置換の炭素数 3 ~ 15 個の環状アルキル基を表す。

m は、1 ~ 4 の自然数である。

【請求項 4】 (b - 1) の化合物が、活性光線又は放射線の照射によりスルホン酸を発生する化合物であり、(b - 2) の化合物が、活性光線又は放射線の照射によりカルボン酸を発生する化合物であることを特徴とする請求項 1 に記載のポジ型感放射線性組成物。

【請求項 5】 有機塩基性化合物を含有することを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載のポジ型感放射線性組成物。

【請求項 6】 請求項 1 ~ 5 のいずれかに記載のポジ型感放射線性組成物により膜を形成し、当該膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。